

عنوان مقاله:

بررسی ممانعت کنندگی دوشیف باز جدید بر روی مس در اسید سولفوریک نیم مولار

محل انتشار:

اولین همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن ریخته گری ایران (سال: 1386)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

فاطمه بقایی راوری - عضو هیئت علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطهره دادگری نژاد - عضو هیئت علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

مطالعه بازدارندگی دوشیف باز با نامهای bis-(2-hydroxy-3-methoxy)-1,6-diaminohexane و bis-(2-hydroxy)-1,6-diaminohexane روی مس در اسید سولفوریک نیم مولار با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی AC امپدانس و پلاریزاسیون تافل انجام شده است نتایج بدست آمده از منحنیهای نایکوئیست نشان میدهد که افزایش غلظت این دو شیف باز باعث افزایش مقاومت انتقال بار و کاهش ظرفیت لایه دوگانه و در نتیجه باعث افزایش راندمان حفاظت آنها برای مس در اسید سولفوریک نیم مولار شده است این دو شیف باز ممانعت کننده های مناسبی برای مس در اسید سولفوریک نیم مولار هستند و هر دو ماده از نوع ممانعت کننده های آندی می باشند و بصورت جذب شیمیایی بر روی سطح مس مانع از خوردگی آن می شود و این دو شیف باز از جذب ایزوترم لانگمیر پیروی می کنند.

کلمات کلیدی:

شیف بازها، AC امپدانس، ممانعت کننده، ایزوترم لانگمیر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/137472>

